Advanced applications established by MIRRORCLE type tabletop synchrotron light sources

H. Yamada^{1,2}, T. Hanashima², D. Hasegawa², T. Yamada², M. Yamada², Y. Yano¹, M. Mizuta¹

¹⁾ Ritsumeikan University

1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu City, Shiga 525-0758

²⁾ Photon Production Laboratory Ltd.

4-2-1-808 Takagaicho Minami, Omihachiman, Shiga 523-0898

Abstract

MIRRORCLE-CV4 及び CV1 が完成して様々な利用に供されているが、"みらくる"でしか行うことの出来な い特徴的な利用がクローズアップされている。例えば、マイクロCT、分散型 XAFS、微小角散乱実験、大 型構造物の非破壊検査である。電子蓄積リングを戸外に持ち出し、実際の橋梁検査を行うことができた。 電子蓄積リングを戸外に持ち出した世界で初めての例である。

1. はじめに

"みらくる"はさらに進化を続けている。電子エネルギー4MeVと1MeVの"みらくる"が完成した。
4MeV装置を、MIRRORCLE-CV4、1MeV装置を
MIRRORCLE-CV1と呼んでいる。CV4の100keV領域に 於けるX線フラックスは、6MeV装置より5倍強く、
CV1の10keV領域での強度はCV4の10倍という結果が出ている。CV4及びCV1がX線利用の実用マシンであり、CV4は構造物の非破壊検査に優れ、CV1は高度分析利用に優れている。CV1の運転には、放射線主任者を必要としないのも大きな利点である。

"みらくる"の利用で、第1に注目されるのがマ イクロ CT である。マイクロフォーカスX線管によ る CT が産業界では広く使われていて、1~10um の 焦点サイズをだしている。しかしながら、金属ケー スに入った LSI や Li イオン電池の帯状電極の内部 構造は透過力が不足して見ることが出来ない。

"みらくる"では、微小球状ターゲットに 6um の金属を使用して、実効的に 3um の解像度を出して いる。1um ワイヤターゲットでファンビーム CT を 行うと、サブミクロンの解像度を出すことができる。 検出器の解像度が 10 ミクロンでも、20 倍拡大で、 0.5um を達成できる。"みらくる"のX線スペクト ルは、MeV 領域まで発生するので、上記のアプリ ケーションには適切である。

CV4 を用いた非破壊検査にはユーザーから多くの リクエストが来ている。橋桁の検査も一例である。 60cm コンクリートに埋め込まれた、シース管の内 部を詳細に見ることができる。

次に希望が多いのが、XAFS である。"みらく る"で行う XAFS は、分散型 XAFS であり、数 10keV の領域で 500eV のバンド幅を一度に測定できる。湾 曲結晶を用いて、一つのスペクトルを 30 分ほどで とることができる。大型放射光では波長をスキャン しなければならないから、結局時間がかかる。 30keV 以上の吸収端を見ることが出来るのが特長で ある。

小角散乱では、ブロックコリメータを用いて、幅 60µmのX線を取り出すことができる。大型放射光 では、概ね100umのビームを切り出して小角散乱を 行っているが"みらくる"の光源点は、数µmの オーダーであるから、我々が行うのは微小角散乱と 言って良い。XAFS及び微小角散乱は、CV1を用いて 行うよう、現在準備を進めている。

2. MIRRORCLE-CV シリーズ

CV シリーズは、軌道半径が 6X の半分の 8cm であ る。リングは矩形であり、その一辺は 35cm である。 永久磁石を使用して軽量化を図っているので、入射 器のマイクロトロンを含めて総重量は、1t 以下に 収めることができた。図1は完成した、MIRRORCLE-CV4 である。



図1 MIRRORCLE-CV4

X線強度について述べると、電子エネルギーが低いので 1/ ルールに従って、X線の発散角が大きくなるため、光子密度が下がると考えて良いが、電子エネルギーが低い分マイクロトロンのデューティーを上げることができる。

CV1 は、現在パルス幅 100ns、繰り返し 1kHz で運転しているが、㈱光子発生技術研究所によるコマーシャルプロダクトは 10kHz となる。CV4 は、現在、500Hz であるが、10kHz にする予定である。

さらに最近マイクロトロン入射器の効率を著しく 高めることができた。<u>4MeV マイクロトロンでは、</u> 最大電流値 260mA を出している。1MeV マイクロト ロンの電流値は、300mA であるが、理論的には 500mA 出すことができる。キャビティーのエージン グが進み、Q 値が上がり、大パワーを投入できれば、 さらに電流値を上げられると考えている。この電流 値はライナックのそれと比較して著しく高い。我々 は、Kapitza 型のマイクロトロンに収束要素を導入 して加速効率を飛躍的に高めた。

ターゲットを挿入して発生したX線強度を規格化 された DOSE モニター(イオンチェンバー)を用い て計測した値を表1に示す。実測値に基づいて、 10kHz 運転をしたときの値を示している。

	Dose rate[mGy/min @1mdistqance]				beam current,
model	Model #23342	Model #31013	Model #31013	Xray target type	repetition,
	soft xray (8 - 30 keV	hard xray (< 150 keV)	hard xray (~1.3 MeV)		timing window
CV1	6100	3200	18	Cu 30um foil	300mA,
					10kHz, 100ns
CV4	344	979	1088	W 30um ball	200mA,
					10kHz, 100ns,
6X	-	10	24	W 30um ball	120mA,
					400Hz,
20SX	-	-	11	Be 100um thick	120mA,
				sheet	500Hz,

表1 X線強度

この表から分かるように、CV1 及び CV4 のX線強 度は 6X や 20SX と比較して著しく向上している。 特に低エネルギーX線成分が増加している。逆説 的に述べるならば、高エネルギー電子を用いた場 合の低エネルギーX線強度が、理論で予測された よりもかなり低かったことが問題と思われる。理 由として、制動放射に於けるスクリーニング効果 を上げることができる。高エネルギー電子ビーム のスクリーニング効果は、実験的には必ずしも良 く解明されていない。高エネルギー電子では、低 エネルギー制動放射がかなり抑制されているよう であり、物理の問題として興味深い。

この結果をもって、我々は、"みらくる"プロ ジェクトにおいて、やっと初期の目標を達成する ことができた。"みらくる"のX線強度は、実用 段階に到達した。CV4 は、高エネルギーのX線強度 から分かるように、重構造物の非破壊検査に優れ ており、自動車エンジンの内部を、10um の精度で 非破壊検査ができ、CT で断層を見ることができる。 CV1 の低エネルギーX線強度は、分散型 XAFS で1 つのスペクトルを数分でとることが出来る強度で ある。

3. X線利用

3.1 非破壊検査

1MeV 以上の高輝度X線で、10um という解像度を 出せる装置は、MIRRORCLE-CV4 以外には無い。その 様な中で、安全・安心がキーワードとして登場し たことと、リコールに対するリスクヘッジが生産 技術に不可欠となったことにより、CV4 に対する期 待が高まり、"みらくる"の利用希望者が増加し ている。 以下に、幾つかの特徴的な非破壊検査 例を紹介する。



図2 1.5cm 鋼板に人工的に形成したクラック (左図)を約3倍拡大で透視した(右図)物であ る。表面に見られる以外のクラックが多数見えて いる。IPを用いた撮像時間は数分である。電源設 備協会の依頼で行った。



図 3 積層 LSI の 25 倍拡大像。貫通ピアーとその

鋼材

鉄筋

空洞

周りの電極が見える。(上)は、正面から見たと き、(下)は、35度横から見たときである。貫通 ピアーの深さ方向構造が見えている。



密着 ← 50mm ← 6mm 38mm



図4 60cm コンクリート(上段)に埋め込まれた シース管を CV4 で透視。(中段)は密着撮像、 (下段)は2倍拡大像である。シース管は、1mm 厚 のアルミでできており、中に鋼材とグラウトと呼 ばれる充填材が入っている。鋼材がさびるのを保 護する目的である。グラウトの充填状態を調べる ことと鋼材の切断状況を調べることが目的である。

3.2 高度分析利用

XAFS に対する需要が大きいが、しばらく前に "みらくる"を用いた XAFS のデモを行っているの で本稿では述べない。追加事項として述べること は必要計測時間についてである。20SX を用いた時 は約5時間を必要としたが、CV1 の低エネルギー強 度が 100 倍向上したことにより、現在では、約3 分で1つのスペクトルをとることができる。光学 系をしっかりとデザインすれば、さらに高速にす ることができる。我々の XAFS は分散型であり、早 い現象の解明に優れていると思われる。

次に述べるのは、小角散乱実験の準備状況についてである。大型放射光では、ブロックコリメータを用いて約 0.1mm のビームを切り出して小角散 乱実験や反射率測定を行っている。

これに対して、"みらくる"のソースサイズは、 6um を達成していて 60um 幅のビームを形成してい る。図5は、ビーム形成の様子である。コリメー タの角度を調整しているところであるが、アライ メントが不完全なときに W コリメータ表面からの 反射光が確認される。角度を変えることにより、 反射光の位置が変わり強度も変わる。反射X線強 度はかなりの物である。しばらくして小角散乱実 験を行うが、反射X線を使うのも一つの方法であ る。X線エネルギーは約 30keV である。







ファンビームを切り出している様子。コリメー ションが不完全なとき、表面からの反射光が確認 される。(下段)コリメータの角度を変えて、反 射光が変化する様子を見ている。30keV までのX線 が反射されている。

以上、みらくる型放射光の現状を簡単に紹介したが、"みらくる"が、CV1及びCV4の完成により、 非破壊検査装置及び高度分析装置として完成した ことをご理解いただけたと思う。非破壊検査やC T、XAFSの委託分析を受け付けている。